

(12) International Application Status Report

Received at International Bureau: 19 June 2016 (19.06.2016)

Information valid as of: 06 October 2017 (06.10.2017)

Report generated on: 16 September 2019 (16.09.2019)

(10) Publication number:

WO2017/213657

(43) Publication date:

14 December 2017 (14.12.2017)

(26) Publication language:

English (EN)

(21) Application Number:

PCT/US2016/036765

(22) Filing Date:

09 June 2016 (09.06.2016)

(25) Filing language:

English (EN)

(51) International Patent Classification:

C09K 8/10 (2006.01); *C09K 8/80* (2006.01); *E21B 43/267* (2006.01)

(71) Applicant(s):

HALLIBURTON ENERGY SERVICES, INC. [US/US]; 3000 N. Sam Houston Parkway E. Houston, TX 77032-3219 (US) (*for all designated states*)

(72) Inventor(s):

AGASHE, Snehalata, S.; 3000 N. Sam Houston Parkway. E. Housont, VA 77032-3219 (US)

BIYANI, Mahesh, Vijaykumar; 3000 N. Sam Houston Parkway. E. Houston, TX 77032-3219 (US)

CHITTATTUKARA, Shoy George; 3000 N. Sam Houston Parkway E. Houston, Texas 77032-3219 (US)

EOFF, Larry Steven; 22742 Adrift Row Lane Porter, Texa 77365 (US)

(74) Agent(s):

TUMEY, Corey S.; Tumey L.L.P. P.O Box 22188 Houston, Texas 77227-2188 (US)

(54) Title (EN): SELF-SUSPENDING MATERILAL FOR DIVERSION APPLICATIONS

(54) Title (FR): MATÉRIAU À SUSPENSION AUTOMATIQUE POUR APPLICATIONS DE DIVERSION

(57) Abstract:

(EN): A method of servicing a wellbore in a subterranean formation including combining diverter material and aqueous base fluid to form a diverter fluid, wherein the diverter material is self-suspending and comprises psyllium husk particulates; introducing the diverter fluid into the wellbore; and allowing the diverter material to form a diverter plug in the wellbore or the formation. A method of servicing a wellbore in a subterranean formation including combining diverter material including psyllium husk particulates and a first wellbore servicing fluid; introducing the first wellbore servicing fluid into the wellbore; allowing the diverter material to form a diverter plug in a first location in the wellbore or the formation; diverting the flow of a second wellbore servicing fluid to a second location in the wellbore of formation; and removing the diverter plug, wherein the first and second wellbore servicing fluids may be the same or different.

(FR): L'invention concerne un procédé d'entretien d'un puits de forage dans une formation souterraine consistant à combiner un matériau de diversion et un fluide de base aqueux pour former un fluide de diversion, le matériau de diversion étant à suspension automatique et comprenant des particules d'enveloppe de psyllium ; à introduire le fluide de diversion dans le puits de forage ; et à permettre au matériau de diversion de former un bouchon de dérivation dans le puits de forage ou dans la formation. L'invention concerne un procédé d'entretien d'un puits de forage dans une formation souterraine consistant à combiner un matériau de diversion comprenant des particules d'enveloppe de psyllium et un premier fluide d'entretien de puits de forage ; à introduire le premier fluide d'entretien de puits de forage dans le puits de forage ; à permettre au matériau de diversion de former un bouchon de dérivation dans un premier emplacement dans le puits de forage ou dans la formation ; à dériver l'écoulement d'un second fluide d'entretien de puits de forage vers un second emplacement dans le puits de forage de la formation ; et à retirer le bouchon de dérivation, les premier et second fluides d'entretien de puits de forage pouvant être identiques ou différents.

International search report:

Received at International Bureau: 10 March 2017 (10.03.2017) [KR]

International Report on Patentability (IPRP) Chapter II of the PCT:

Not available

(81) Designated States:

AE, AG, AL, AM, AO, AT, AU, AZ, BA, BB, BG, BH, BN, BR, BW, BY, BZ, CA, CH, CL, CN, CO, CR, CU, CZ, DE, DK, DM, DO, DZ, EC, EE, EG, ES, FI, GB, GD, GE, GH, GM, GT, HN, HR, HU, ID, IL, IN, IR, IS, JP, KE, KG, KN, KP, KR, KZ, LA, LC, LK, LR, LS, LU, LY, MA, MD, ME, MG, MK, MN, MW, MX, MY, MZ, NA, NG, NI, NO, NZ, OM, PA, PE, PG, PH, PL, PT, QA, RO, RS, RU, RW, SA, SC, SD, SE, SG, SK, SL, SM, ST, SV, SY, TH, TJ, TM, TN, TR, TT, TZ, UA, UG, US, UZ, VC, VN, ZA, ZM, ZW

European Patent Office (EPO) : AL, AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HR, HU, IE, IS, IT, LT, LU, LV, MC, MK, MT, NL, NO, PL, PT, RO, RS, SE, SI, SK, SM, TR

African Intellectual Property Organization (OAPI) : BF, BJ, CF, CG, CI, CM, GA, GN, GQ, GW, KM, ML, MR, NE, SN, TD, TG

African Regional Intellectual Property Organization (ARIPO) : BW, GH, GM, KE, LR, LS, MW, MZ, NA, RW, SD, SL, ST, SZ, TZ, UG, ZM, ZW

Eurasian Patent Organization (EAPO) : AM, AZ, BY, KG, KZ, RU, TJ, TM